

<<超大规模集成电路技术基础>>

图书基本信息

书名：<<超大规模集成电路技术基础>>

13位ISBN编号：9787505351950

10位ISBN编号：7505351958

出版时间：1999-5-1

出版时间：电子工业出版社

作者：李兴

页数：255

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<超大规模集成电路技术基础>>

书籍目录

绪论

第一章 硅的晶体结构

第二章 光刻

第三章 掺杂

第四章 氧化及热处理

第五章 薄膜工艺基础与物理气相沉积

第六章 化学汽相沉积 (VCD)

第七章 刻蚀

第八章 平坦化及多重内连线工艺

第九章 超大规模集成电路工艺汇总

<<超大规模集成电路技术基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>